

界面ナノ電子化学研究会は半導体ウェットプロセスに関する様々な企業、研究機関および大学関係者により、半導体製造プロセスの学術的な解明、発展への貢献を重ねてきました。更なる発展のために活発な議論、関係者の交流、若手技術者の育成などを目的としこの度合宿形式の第1回フォーラムを開催することに決定しました。“半導体ウェットプロセスの未来を考える”というテーマを掲げ、著名な方々より興味深い講演を聴講し、様々な年代、幅広い職種の関係者が2日間にわたり学び、交流し、議論する場を提供します。

## 半導体ウェットプロセスの未来を考える

# INEF2016



- 主催： 界面ナノ電子化学研究会(INE)
- 日時： 2016年10月28日(金)13:00~29日(土)12:00
- 場所： 信州上諏訪温泉「浜の湯」  
〒392-0027 長野県諏訪市湖岸通り3-3-10  
《交通》JR中央本線 上諏訪駅より徒歩5分  
《地図》<http://www.hamanoyu.co.jp/access/>

### ■プログラム：

- 1日目(10月28日)
- 13:00~13:10 開会挨拶 真田俊之(静岡大)
  - 13:10~14:10 基調講演「裏面照射型CMOSイメージセンサ開発経緯と今後の展望」  
岩元勇人(ソニー)
  - 14:10~15:10 基調講演「極薄水膜内の固体表面の原子スケール周波数変調AFM観察(仮題)」  
新井豊子(金沢大)
  - 15:10~15:40 UCPSS 2016レポート 真田俊之(静岡大) 他
  - 15:40~17:30 休憩・自由時間
  - 17:30~18:30 基調講演「人工知能と半導体プロセス」  
湯之上隆(微細加工研究所)
  - 18:30~20:30 第21回カサロス(懇親会) 兼 ランプセッション ~半導体の未来を語り合う~
- 2日目(10月29日)
- 9:00~9:45 招待講演「研究開発者・技術者のマネジメント」  
田中秀樹(青森公立大)
  - 9:45~10:30 招待講演「水の話」  
山中弘次(オルガノ・長岡技科大)
  - 10:30~11:50 ラウンドテーブルセッション(ポスターセッション)
  - 11:50~12:00 閉会挨拶 富田寛(東芝)

- 参加費：フォーラム参加費先行予約¥15,000(9月1日以降は¥20,000)、宿泊費¥12,000(食事、カサロス(懇親会)費を含む・相部屋) 合計¥27,000(9月1日以降は¥32,000)  
※宿泊されない場合は要問合せ  
※キャンセルポリシー：キャンセル料は次の通り発生します。前日100%、7日前50%  
※支払方法：銀行振込(お申込頂いた方へ振込先をご連絡致します、振込手数料はご負担ください)
- 定員： 先着50名
- 申込： 参加者の①所属機関 ②部署名 ③役職名 ④電話番号を記載の上、下記までお申し込みください。  
INE事務局 吉田勇喜(関東化学)

[yoshida-yuki@gms.kanto.co.jp](mailto:yoshida-yuki@gms.kanto.co.jp)